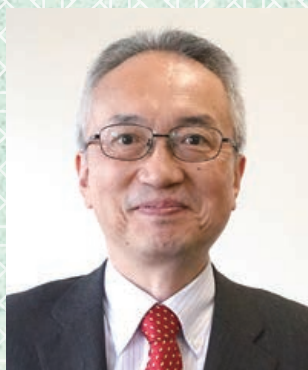


年頭所感 ● 2020



特許技監
嶋野 邦彦

新年明けましておめでとうございます。2020年の年頭にあたり、ご挨拶を申し上げます。

知的財産を取り巻く環境は、平成の30年の間に大きく変わりました。情報通信技術の飛躍的な進展をベースとした様々な分野での技術革新、研究開発や企業活動のグローバル化などを背景に、ビジネスは進化を遂げています。

こうした変化の中にあって、特許庁は、我が国の持続的な経済発展を知的財産の側面から支えるため、様々な施策に取り組んできました。積年の課題であった特許審査の迅速化についても、ユーザーの方々のご協力の下、2014年の3月に一次審査期間を11ヶ月にするという目標を達成し、その後は、2023年に向けた10年間の目標として世界最速・最高品質の特許審査の実現を掲げ、業務に取り組んでいます。引き続き、早期に安定した権利を付与すべく審査を徹底していきます。

特許審査は、新たな技術や、これを利用した新たなビジネスにも、適切に対応していかなければなりません。AI技術が様々なビジネスに活かさ

れ、AI関連の特許出願が技術横断的に増加する中で、AIに関連する発明をどのように保護していくか、世界が注目しているテーマです。

昨年、特許庁では、AI関連技術に関する特許審査に関して、記載要件や進歩性についての判断のポイントを分かりやすく示すため、世界に先駆けて審査事例を作成し、公表しました。

また、AI関連発明の特許審査実務について、国際シンポジウムを東京で開催しました。日米欧中韓の五庁とアジアの実務者が一堂に会し、各庁での判断のポイントや権利を取得するための留意点、各庁が今後取り組むべき施策等について活発な議論がなされました。

これからも、AI等の新技術の権利化に関する国際的な議論をリードするとともに、ユーザーの方々にとって予見性の高い審査を目指していきます。

長年にわたって技術が発展し、様々なインフラも整備されてきた先進国に比べ、新興国・途上国では未解決の課題が数多く存在しています。これらの課題は見方を変えるとその国に特有の多様なニーズと捉えることが出来ます。こうしたニーズに、先進国の持つシーズがマッチングすることで、イノベーションが起こり、その国の経済が発展していく可能性があります。このような状況は、優れた技術を備えた我が国の企業にとって大きなビジネスチャンスとなり得ます。

特許庁は、こうした新興国・途上国を含め世界各国との協力を進めています。我が国産業界の貿易・投資活動のグローバル化に対応するため、2019年には、これまでアジア・太平洋及びアフリカ地域を支援するためにWIPOに拠出してきたWIPOジャパンファンドの支援対象地域を、全世界に拡張しました。

また、1996年から行ってきた、途上国の知的財産関係者に向けた研修プロジェクトでは、これ

までにアジア太平洋地域を中心として6,600名以上の研修生を受け入れ、権利化や権利行使に関わる人材の育成を支援してきました。

ユーザーの方々が各国で権利を取得する際の負担を軽減することも重要です。我が国が提唱し、2006年より開始した特許審査ハイウェイ (PPH) については、対象国を拡大し、内容を充実させてきました。

ブラジルとのPPHでは、従来は対象技術がIT・機械といった技術分野に限られていましたが、昨年、その制限が撤廃され、全ての技術分野で申請ができるようになりました。ベトナムとのPPHについては、ベトナム側の受入れ件数が拡大されました。12月には、待望のインドとのPPHが開始されました。さらに、本年1月からはサウジアラビアとのPPHが開始され、対象は、世界最大となる44の国・地域まで広がっています。

こうした国際的な協力を進めていく上で、各国の審査の基礎となる、我が国の審査、審判の責任は重くなっています。審査、審判の実務を着実に進めていくとともに、引き続き、各国の知的財産庁との協力を進め、我が国の企業等の国際的なビジネスをサポートしていきます。

国際的な知的財産紛争が活発化する中、企業活動のグローバル化を知的財産の側面から支援していくためには、審判や司法における国際連携も重要です。これまでも欧米やアジア各国との間で審判部間の交流を続け、各国の審判制度や実務の状況に関する情報交換と公表に努めてきました。2017年からは、日本及び海外諸国の知的財産に関する司法制度の最新情報を、ユーザーの方々に提供すべく、「国際知財司法シンポジウム」を、裁判所等との共催により毎年開催しています。本年は、米国及び欧州の裁判官・審判

官を招いて開催する予定です。

新しい技術やビジネスが生まれていく中で、これに知的財産制度が十分に対応できているのか、運用がユーザーの方々の期待に十分応えられているのかという観点から、見直すことも必要です。

昨年5月に公布された「特許法等の一部を改正する法律」では、訴訟制度の充実を図り、損害賠償額の算定方法が見直されるとともに、特許権の侵害の可能性がある場合、中立な技術専門家が現地調査を行う査証制度が導入されました。意匠法については、画像や、建築物、内装のデザインが新たに意匠法の保護対象になりました。また、関連意匠の出願可能期間が延長され、意匠権の存続期間も出願日から25年になりました。改正法は、一部の規定を除き4月に施行されます。これに向けて、現在、意匠審査基準を整備しているところです。新たな意匠制度をユーザーの方々に円滑に利用していただくことができるよう、制度及び運用の周知に努めてまいります。

デジタル革命が進み、ビジネスの自由度が格段に高まっていくなかで、知的財産システムの重要性は一層増していきます。この新たな環境の中で、我が国の経済活動が促進されるよう、引き続き制度と運用の見直しを図ってまいります。

最近では、特許庁はデザイン経営という手法を取り入れ、若手職員の積極的な提案も取り入れながら、施策を検討する取組を行っています。新たに、2025年の万博に向けて、知的財産システムの将来像を検討するプロジェクトも発足させました。これからも、ユーザーの方々の視点に立って、新しい時代に求められる特許庁の姿を常に探求し、引き続き力を尽くしていきましょう。

最後に、皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げて、新年のご挨拶とさせていただきます。